

電子材料用高純度ガス 事業紹介

株式会社レゾナック
エレクトロニクス事業本部
情報電子化学品事業部
ファイン製品部 国内営業グループ

2023年11月1日版

The logo for RESONAC, featuring a stylized blue 'R' icon followed by the word 'RESONAC' in a bold, blue, sans-serif font.

昭和電工株式会社と昭和電工マテリアルズ株式会社は、
2023年1月1日に統合し、新会社「レゾナック」に生まれ変わりました。
当社グループは、新社名でのスタートを「第二の創業」と捉え、
グループ内や化学業界だけでなく、
さまざまなステークホルダーとの共創を通じて、
先端材料パートナーとして時代が求める機能を創出し、
グローバル社会の持続可能な発展に貢献していきます。

RESONAC
Chemistry for Change

Purpose

存在意義

化学の力で社会を変える

先端材料パートナーとして時代が求める機能を創出し、
グローバル社会の持続可能な発展に貢献する

Values

私たちが大切にしている価値観

- ▶ プロフェッショナルとしての成果へのこだわり
- ▶ 機敏さと柔軟性
- ▶ 枠を超えるオープンマインド
- ▶ 未来への先見性と高い倫理観

社名 株式会社レゾナック

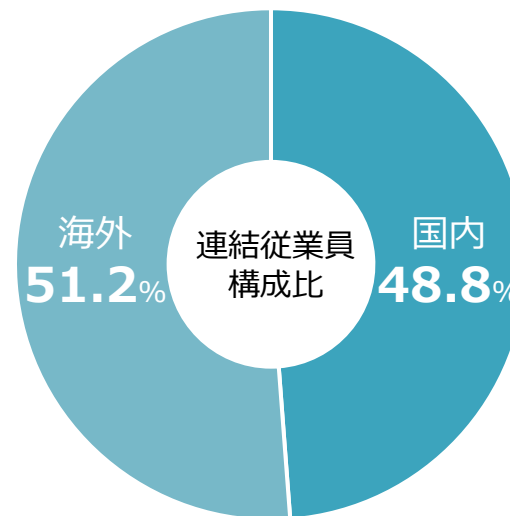
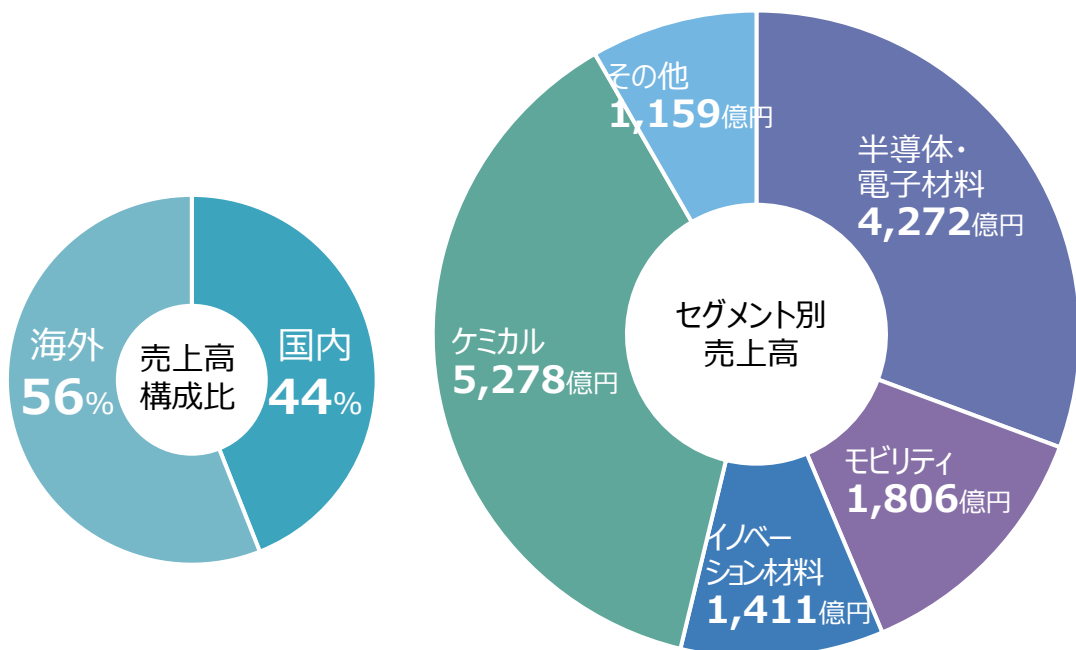
設立 1962年10月

連結売上高 1兆3,926億円

資本金 155億円

本社所在地 東京都港区芝大門1-13-9

連結従業員数 26,295名



連結子会社 124社

※2022年度実績

事業セグメント・製品の紹介

半導体・電子材料

半導体前工程材料 / 半導体後工程材料 / ハードディスク / SiC

モビリティ

自動車部品 / リチウムイオン電池材料

イノベーション材料

機能性化学品 / 樹脂材料 / コーティング材料 / セラミックス / アルミ機能部材

ケミカル

石油化学 / 化学品 / 黒鉛電極

その他

半導体製造の前工程・後工程を幅広くカバーする製品を展開し、
ワンストップソリューションを提供しています。
半導体の技術革新を素材の力で牽引していきます。



主要製品

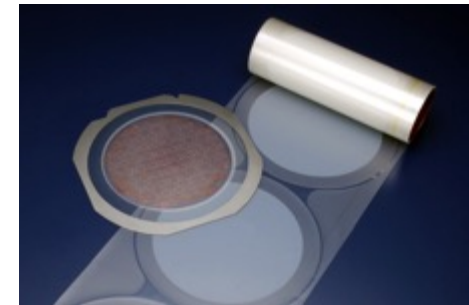
電子材料用高純度ガス



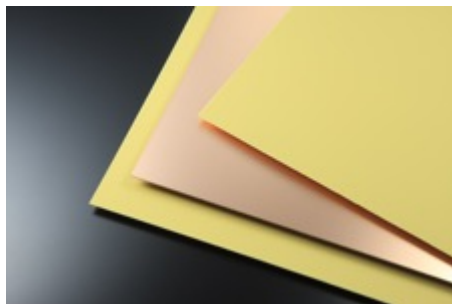
CMPスラリー



ダイボンディングフィルム



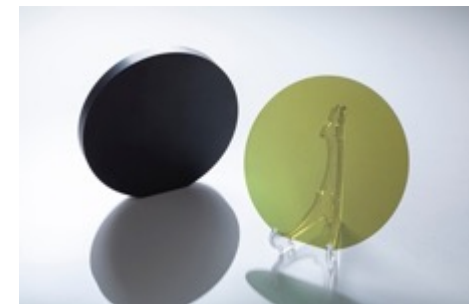
ガラスエポキシ多層材料「MCL」



ハードディスク



SiCエピタキシャルウェハー



CASE、特にxEVの進展に伴い、
当社の軽量化、電動化、熱制御技術など、
次世代自動車に求められる製品・技術開発に注力しています。



主要製品

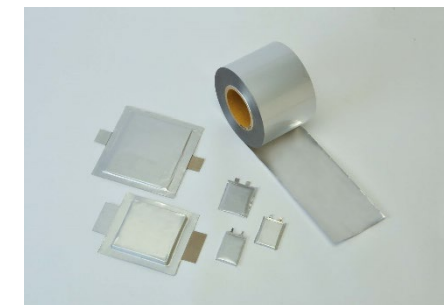
樹脂製バックドアモジュール



樹脂ギヤ



アルミラミネートフィルム



粉末冶金製品



ブレーキパッド



リチウムイオン電池用負極材

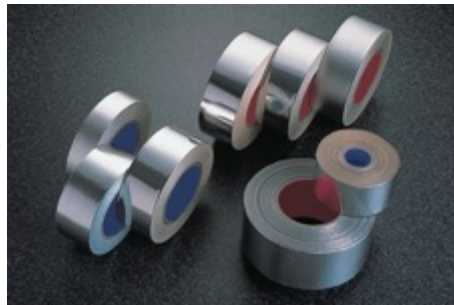


当社の事業群のイノベーションや競争力強化を支える
技術プラットフォーム事業として、
幅広い技術・素材を提供しています。

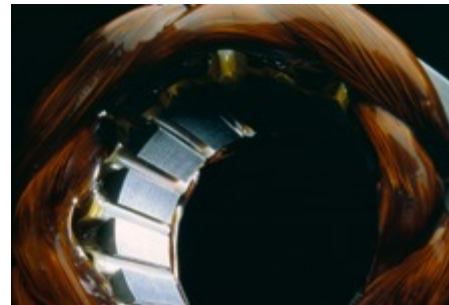


主要製品

合成樹脂エマルジョン「ポリゾール」



電気絶縁ワニス



ノンスティック・コーティング剤



コンデンサー用セラミックス



アルミニウム casting 棒・鍛造品



不飽和ポリエステル





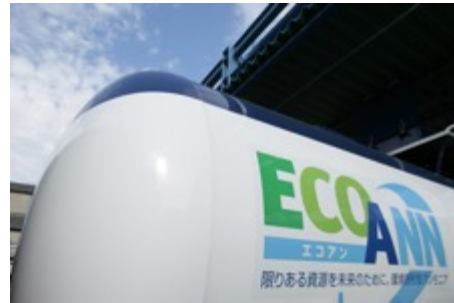
さまざまな産業の起点・インフラとなる製品を提供するとともに、製造工場のCO₂排出量削減などカーボンニュートラルに向けた技術開発に取り組んでいます。

主要製品

エチレン



アンモニア「エコアン」



黒鉛電極



炭酸ガス・ドライアイス



ポリプロピレン



体外診断用医薬品の製造・販売や、再生医療等製品※の製法開発・受託製造などを行っています。



主要製品

再生医療等製品の製法開発・受託製造サービス



Minaris Regenerative Medicineでは、製薬会社などからの委託を受け、品質管理システムを導入した無菌製造施設で、再生医療等製品の製法開発・受託製造を行っています。日欧米に拠点を持ち、グローバルな供給体制の下、再生医療の普及に貢献しています。

※人または動物の細胞に培養等の加工を施したもので、疾病の治療・予防を目的として使用するもの

生化学自動分析装置用試薬



電子材料用高純度ガス 事業紹介

国内拠点

営業 / 製造 / 物流拠点

海外拠点

中国 / 台湾 / 韓国 / シンガポール / 北米 / 欧州

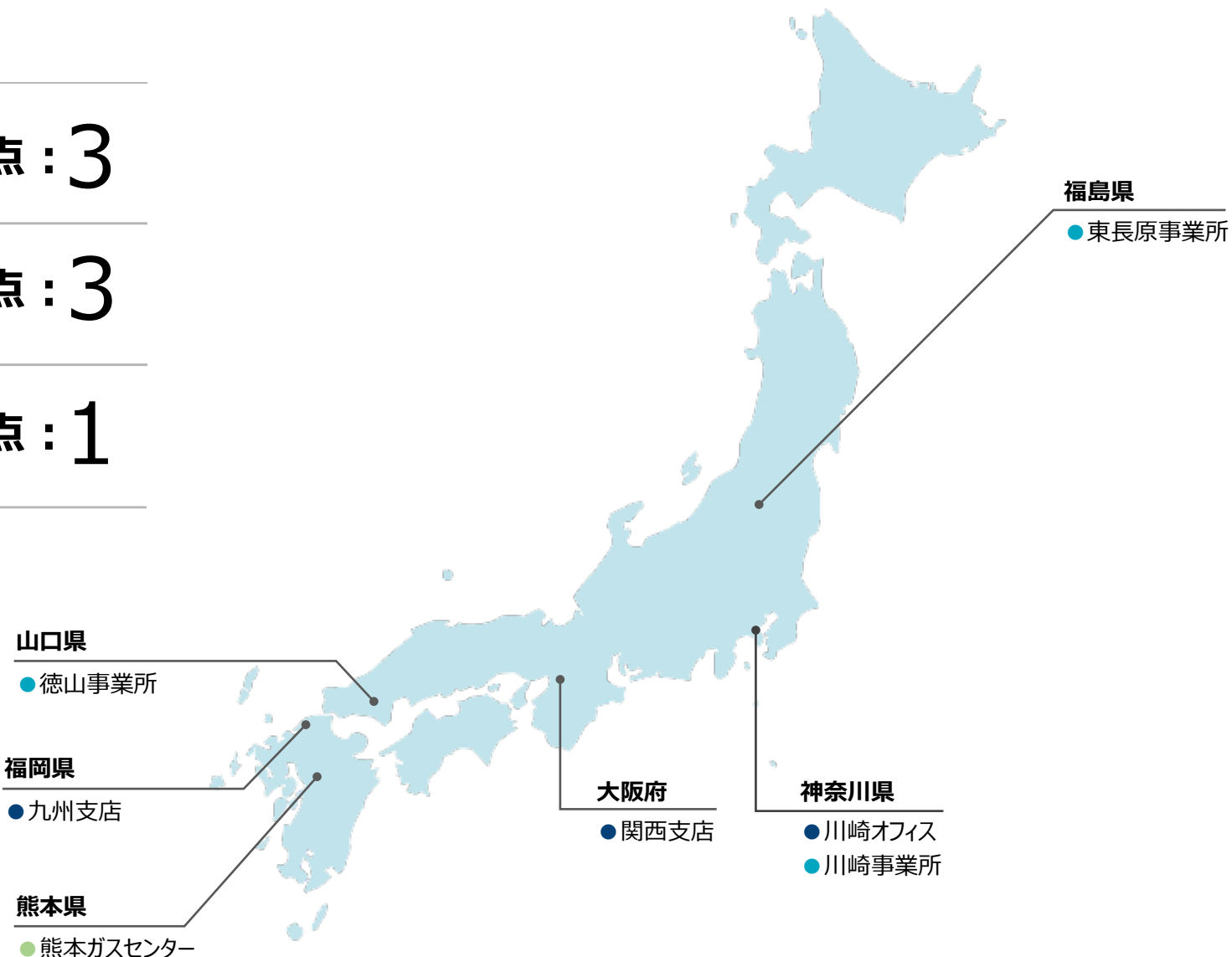
製品紹介

フッ素系 / 臭素・塩素系 / 窒素系

● 営業拠点 : 3

● 製造拠点 : 3

● 物流拠点 : 1



(23年6月1日時点)

● 営業拠点 : 6

● 製造拠点 : 6

● 物流拠点 : 5

韓国

- Resonac Korea Corp.
- SK resonac Corp.
- 安城ガスセンター

北米

- Resonac America, Inc.

台湾

- Resonac Specialty Gas Taiwan Co.,Ltd.
- Resonac Chemicals Manufacturing Taiwan Co.,Ltd.

シンガポール

- Resonac Specialty Gas Singapore Pte. Ltd.

欧州

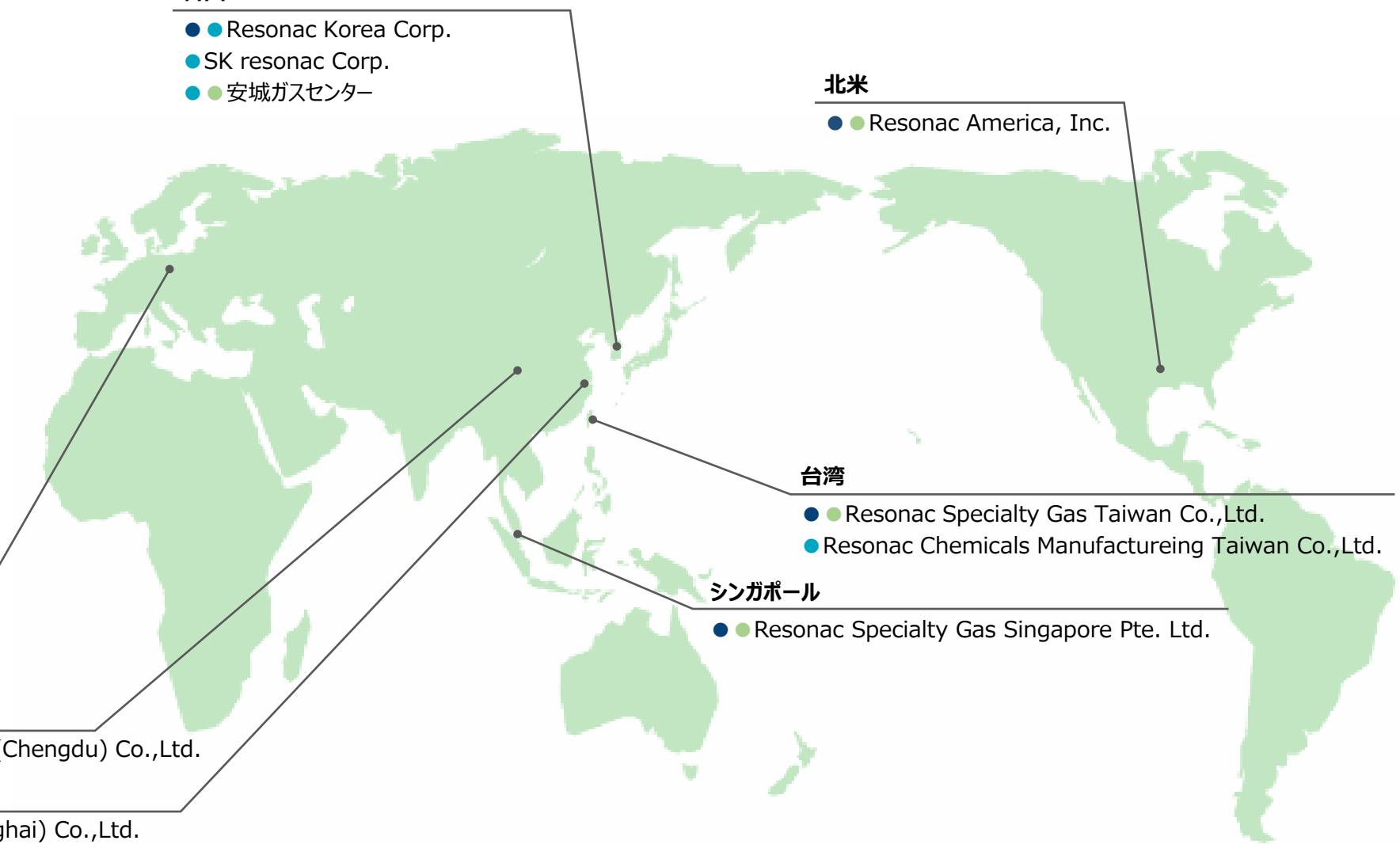
- Resonac Europe GmbH

成都

- Kemeite Resonac Electronic Materials (Chengdu) Co.,Ltd.

上海

- Resonac Chemicals (Shanghai) Co.,Ltd.
- Resonac Electronic Materials (Shanghai) Co.,Ltd.



(23年6月1日時点)

No.	分類	製品名	化学式	荷姿	純分	口金仕様	製造場所	主な用途	製品Website
1	フッ素系	高純度 FC-14	CF ₄	10L/6kg 47L/32kg	5N7	W22mm 14山 右ネジ	中国	エッチング	FC-14
				10L/7kg 47L/30kg			川崎		
2		高純度 FC-116	C ₂ F ₆	10L/8kg 47L/40kg	5N3	W22mm 14山 右ネジ	川崎	クリーニング	FC-116
3		高純度 FC-218	C ₃ F ₈	10L/8kg 47L/50kg	3N5	W22mm 14山 右ネジ	川崎	クリーニング	FC-218
4		高純度 FC-2316	C ₄ F ₆	10L/10kg 47L/45kg	4N	W22mm 14山 左ネジ	川崎 韓国	エッチング	FC-2316
5		高純度 FC-C318	C ₄ F ₈	10L/10kg 47L/50kg	5N	W22mm 14山 右ネジ	川崎 台湾 中国	エッチング クリーニング	FC-C318
6		高純度 HFC-23	CHF ₃	10L/8kg 47L/35kg	5N	W22mm 14山 右ネジ	川崎	エッチング	HFC-23
7		高純度 HFC-41	CH ₃ F	10L/2.5kg	4N	W22mm 14山 右ネジ	川崎 韓国	エッチング	HFC-41
8	高純度 HF	HF	10L/8kg	5N	W22mm 14山 右ネジ	川崎	エッチング クリーニング		

No.	分類	製品名	化学式	荷姿	純分	口金仕様	製造場所	主な用途	製品Website
9	フッ素系	高純度 SF ₆	SF ₆	10L/10kg 47L/50kg	5N	W22mm 14山 右ネジ	川崎 台湾	クリーニング	SF₆
10		20% F ₂ /N ₂	F ₂ /N ₂	47L/0.7kg 5MPa		W22mm 14山 右ネジ	川崎	クリーニング	
11		高純度 SiF ₄	SiF ₄	10L/5kg 47L/30kg	5N	W22mm 14山 右ネジ	川崎	エッチング 光ファイバー	
12	臭素・ 塩素系	高純度 HBr	HBr	10L/10kg 47L/50kg	5N	W22mm 14山 左ネジ	川崎 韓国	エッチング	HBr
13		高純度 Cl ₂	Cl ₂	10L/10kg 47L/50kg	5N	W26mm 14山 右ネジ	川崎 台湾	エッチング	
14		高純度 HCl	HCl	10L/5kg 47L/25kg	5N	W26mm 14山 右ネジ	川崎	エッチング クリーニング	
15		高純度 BCl ₃	BCl ₃	10L/10kg 47L/50kg	5N	W26mm 14山 右ネジ	川崎	エッチング	BCl₃
16	窒素系	高純度 NH ₃	NH ₃	10L/5kg 47L/24kg	5N	W22mm 14山 左ネジ	川崎 台湾	成膜	NH₃
17		高純度 N ₂ O	N ₂ O	10L/7.5kg 47L/30kg	5N	W22mm 14山 右ネジ	川崎 韓国 中国	成膜	N₂O
18	その他	高純度 SO ₂	SO ₂	10L/10kg 47L/50kg	3N	W22mm 14山 右ネジ	川崎	エッチング	

※各ガスのSDSに関しては、以下ページからダウンロードをお願いいたします

[SDSダウンロードページへのリンク先](#)

RESONAC

Chemistry for Change